

TIPLONews 한국어본

2026 년 3 월호(K319)

이달의 주제

K260226Y1

01 대만 지혜국은 2025 년 주목해야 할 100 대 전리(專利)를 발표

대만 지혜국은 2026 년 2 월 26 일, 2025 년 전리(專利)¹⁾ 출원 및 등록 통계를 발표했다. TSMC²⁾는 1,485 건의 특허를 출원하며 10 년 연속 대만 기업 중 가장 많은 특허를 출원했고, 외국 기업 중에서는 Applied Materials(미국)가 연속 1 위를 차지하였고, 1,088 건으로 역대 최고치를 기록했다. 연구기관 중에서는 ITRI³⁾이 328 건으로 가장 많은 출원을 했고, 대학가운데는 성공대학⁴⁾이 134 건으로 1 위를 차지했다. 특허 등록 건수에서는 TSMC가 1,543 건으로 대만 기업 중 1 위를, Applied Materials가 684 건으로 외국 기업 중 1 위를 기록했다.

1. TSMC 는 10 년 연속 대만 특허 출원 건수 1 위를 차지

TSMC 는 2016 년부터 10 년 연속 특허 출원 건수 1 위를 차지했으며, 2025 년에는 1,485 건의 특허를 출원할 것으로 예상되어 연평균 5%의 증가율을 보일 것으로 예상된다. TSMC 에 이어 AUO⁵⁾ (397 건), Foxconn⁶⁾(340 건), Nanya⁷⁾ (328 건), ITRI(328 건), Inventec⁸⁾(316 건), Realtek⁹⁾(286 건), Delta Electronics¹⁰⁾(280 건), MediaTek¹¹⁾(269 건), Innolux¹²⁾(235 건) 순으로 특허 출원 건수가 많았다. 이 중 3 위를 차지한 Foxconn 은 상위 10 개 기업 중 가장 높은 연평균 증가율인 31%를 기록했으며, 8 위 Delta Electronics 는 약 18 년 만에 최고치를 경신했다.

대만내 특허 출원 상위 20 대 기업 중 China Steel¹³⁾은 143 건의 출원으로 14 위를 기록하며 2013 년과 같은 역대 최고치를 경신했다. Wistron¹⁴⁾은 141 건의 출원으로 15 위를 기록하며 약 11 년 만에 최고치를 경신했다.

2. 미국 Applied Materials 는 여전히 외국인 특허 출원 1 위 기업 유지

Applied Materials 는 1,088 건의 특허 출원을 제출하여 2 년 연속 1 위를 차지했다. Tokyo Electron¹⁵⁾(773 건)가 2 위로 도약했고, 그 뒤를 Samsung (741 건), Coupang(675 건), 미국 Qualcomm(570 건), 일본 Kioxia¹⁶⁾(454 건), 일본 Nitto Denko¹⁷⁾(406 건), 일본 Shin-Etsu Chemical¹⁸⁾(359 건), 미국 Lamb Research¹⁹⁾(276 건), 일본 Resonac ²⁰⁾(270 건)가 이었다. 이 중 6 위를 차지한 일본 Kioxia 는 상위 10 개 기업 중 가장 높은 105%의 전년 대비 증가율을 기록했다.

상위 20 대 외국 특허 출원 기업을 살펴보면, 9 개 기업이 역대 최고치를 경신했다. 이에는 1 위인 Applied Materials(미국), 2 위인 Tokyo Electron (일본), 8 위인 Shin-Etsu Chemical(일본), 9 위인 Lamb Research(미국), 10 위인 Resonac(일본), 11 위인 SCREEN Holdings²¹⁾(일본, 263 건 출원), 15 위인 일본 Panasonic IP management²²⁾ (일본), 16 위인 Wonderland Switzerland (스위스), 그리고 19 위인 SK hynix (한국, 153 건 출원)를 포함된다.

3. ITRI가 연구기관 부문에서 19개 연속 1위를 차지, 성공대학은 4년 연속 대학 부문 1위를 차지

연구기관별로 살펴보면, 대만내 특허 출원 건수 상위 100 위 안에 4 개 기관이 이름을 올렸다. ITRI 은 328 건의 출원으로 4 위를 기록하며 2007 년부터 19 년 연속으로 연구기관 중에서는 선두 자리를 유지했다.

대만내 특허 100 대 순위에 오른 22 개 대학 중, 성공대학 134 건의 특허로 4 년 연속 1 위를 차지했다. 명지과기대 ²³⁾는 86 건의 특허로 처음으로 10 위권에 진입하며 2 위를 기록했다. 그 뒤를 이어 양명교대 ²⁴⁾(83 건), 대만과기대 ²⁵⁾(73 건), 중흥대학 ²⁶⁾(70 건), 근익과기대 ²⁷⁾(69 건), 청화대학 ²⁸⁾(67 건), 중산대학 ²⁹⁾(61 건), 병동과기대 ³⁰⁾(60 건), 대만대학 ³¹⁾(60 건) 순으로 순위가 매겨졌다.

특허, 실용신안, 디자인등 세 가지 유형의 산업재산권을 합산한 순위에서 성공대학(154 건)이 1 위로 도약했으며, 대북시과기대 ³²⁾(140 건)가 2 위를 차지했는데, 이 대학은 주로 실용신안을 출원했다.

역주:

- 1) 대만의 전리(專利)에는 發明專利(특허권 상당), 新型專利(실용신안권 상당), 設計專利(디자인권 상당)의 3 종류가 있다. 이는 한국의 산업재산권에 대응한다고 볼 수 있다. 그런데, 한국은 산업재산권에 상표권을 포함하는 반면, 대만에서는 상표권이 별도로 분류, 관리된다. 여기서는 편의상 專利는 전리(專利)로 發明專利는 특허로 번역했다.
- 2) 중국어명 台灣積體電路製造股份有限公司, 영어명 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. (TSMC)
- 3) 중국어명 工業技術研究院, 영어명 Industrial Technology Research Institute (ITRI)
- 4) 중국어명 國立成功大學, 영어명 National Cheng Kung University (성공대학)
- 5) 중국어명 友達光電股份有限公司, 영어명 AUO Corporation (AUO)
- 6) 중국어명 鴻海科技集團, 영어명 Foxconn Technology Group (Foxconn)
- 7) 중국어명 南亞科技股份有限公司, 영어명 Nanya Technology Corporation (Nanya)
- 8) 중국어명 英業達股份有限公司, 영어명 Inventec Corporation (Inventec)
- 9) 중국어명 瑞昱半導體股份有限公司, 영어명 Realtek Semiconductor Corp. (Realtek)
- 10) 중국어명 台達電子工業股份有限公司, 영어명 Delta Electronics, Inc. (Delta Electronics)
- 11) 중국어명 聯發科技股份有限公司, 영어명 MediaTek Inc. (MediaTek)
- 12) 중국어명 群創光電股份有限公司, 영어명 Innolux Corporation (Innolux)
- 13) 중국어명 中國鋼鐵股份有限公司, 영어명 China Steel Corporation (China Steel)
- 14) 중국어명 緯創資通股份有限公司, 영어명 Wistron Corporation (Wistron)
- 15) 일본어명 東京エレクトロン株式会社, 영어명 Tokyo Electron Limited (Tokyo Electron)
- 16) 일본어명 鎧俠株式會社, 영어명 Kioxia Corporation (Kioxia)
- 17) 일본어명 日東電工株式會社, 영어명 Nitto Denko Corporation (Nitto Denko)
- 18) 일본어명 信越化學工業株式會社, 영어명 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.(Shin-Etsu Chemical)

- 19) 영어명 Lam Research Corporation (Lam research)
- 20) 일본어명 株式会社レゾナック・ホールディングス, 영어명 Resonac Holdings Corporation (Resonac)
- 21) 일본어명 株式会社 SCREEN ホールディングス, 영어명 SCREEN Holdings Co., Ltd. (SCREEN Holdings)
- 22) Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. (Panasonic IP management)
- 23) 중국어명 明志科技大學, 영어명 Mingzhi University of Science and Technology(명지과기대)
- 24) 중국어명 國立陽明交通大學, 영어명 National Yang Ming Chiao Tung University (양명교대)
- 25) 중국어명 國立臺灣科技大學, 영어명 National Taiwan University of Science and Technology (대만과기대)
- 26) 중국어명 國立中興大學, 영어명 National Chung Hsing University (중흥대학)
- 27) 중국어명 國立勤益科技大學, 영문명 National Chin-Yi University of Technology (근익과기대)
- 28) 중국어명 國立清華大學, 영어명 National Tsing Hua University (청화대학)
- 29) 중국어명 國立中山大學, National Sun Yat-sen University (중산대학)
- 30) 중국어명 國立屏東科技大學, 영어명 National Pingtung University of Science and Technology (병동과기대)
- 31) 중국어명 國立臺灣大學, 영어명 National Taiwan University (대만대학)
- 32) 중국어명 臺北城市科技大學, 영어명 Taipei City University of Science and Technology (대북시과기대)

K260226Y1

K260226Y2

02 대만 지혜국은 2025 년에 접수된 전리(專利) 및 상표 출원 현황을 발표.

대만 지혜국¹⁾은 2026 년 2 월 26 일 발표를 통해, 2025 년 세 가지 전리(專利)²⁾ 분야(특허, 실용신안, 디자인)에 총 71,965 건의 출원이 접수되었고 이는 2024 년 대비 1% 감소한 수치라고 전하였다. 구체적으로, 특허(51,230 건)는 2024 년 대비 1% 증가하였다. 그런데, 실용신안(14,000 건)과 디자인(6,735 건)은 각각 4%와 8% 감소하였다. 한편, 상표 등록 출원 건수는 97,411 건(124,242 개 분류)으로 역대 최고치를 기록했다. 그리고 2025 년 특허의 평균 최초 승인 소요 기간은 8 개월, 상표는 5.6 개월로, 2024 년 대비 각각 0.4 개월과 0.5 개월 단축되어 기업들이 업계 선도를 위해 더 빨리 권리를 확보할 수 있게 되었다.

1. 대만내 특허 출원 건수는 거의 변동이 없었지만, 실용신안과 디자인의 출원건수는 감소

대만내 특허 출원 건수는 총 19,511 건으로 2024 년 대비 0.4% 소폭 감소했다. 실용신안 출원 건수는 12,574 건, 디자인 출원 건수는 3,192 건으로 전년 동기 대비 각각 6%와 4% 감소했다. 출원인 유형별로는 기업과 연구기관의 특허 출원 건수가 각각 1%와 2% 감소한 반면, 학교는 8% 증가했다. 실용신안 및 디자인 출원 건수는 기업과 연구기관 모두 감소했다.

2. 외국인 특허 출원 건수는 증가한 반면, 외국인의 디자인 출원 건수는 감소

외국인의 특허 출원 건수는 2021 년 이후 꾸준히 증가하여 2025 년에는 31,719 건에 달해 2% 증가할 것으로 예상된다. 일본이 12,524 건으로 1위를 차지하고 있으며, 그 뒤를 미국(6,954 건), 중국 (3,703 건), 한국(3,346 건) 그리고 독일(1,051 건)이 잇고 있다.

외국인이 디자인권에 출원한 건수는 3,543 건으로 전년 대비 12% 감소했다. 일본이 852 건으로 1 위를 차지했고, 미국(621 건), 중국(605 건),

스위스(456 건), 한국(169 건)이 그 뒤를 이었다. 스위스는 23% 증가한 반면, 일본은 3% 감소했고, 미국, 중국 본토, 한국도 15~20% 감소세를 보였다.

3. 대만인의 상표 등록 신청 건수가 역대 최고치를 기록하였고, 외국인의 상표등록 신청 건수 또한 성장

상표 등록 신청 건수가 97,411 건으로 역대 최고치를 기록했으며, 이는 전년 대비 8% 증가한 수치였다.(등록 분류는 124,242 개로 10% 증가) 이러한 증가는 주로 국내 신청 건수가 75,573 건으로 역대 최고치를 기록하며 전년 대비 9% 증가했고, 외국인의 상표등록 신청 건수도 21,838 건으로 4% 증가한 데 기인한다. 외국인의 상표 출원 건수 상위 5 개 국가(지역)의 동향을 살펴보면, 전년 대비 한국이 25% 증가하며 1 위를 차지했고, 미국(+7%), 중국(+3%), 일본(+1%)이 그 뒤를 이었으며, 홍콩은 13% 감소했다.

4. 대만인 상표 등록 출원은 제 35 류에서 가장 많이 이루어졌고, 외국인 상표등록 출원은 제 9 류에서 가장 많이 이루어졌다.

대만인이 출원한 상표 등록 신청 상위 10 개 분야 중 35 류(광고, 기업영업, 소매 및 도매 서비스 등)가 14,913 건으로 가장 많았다. 성장률 측면에서는 42 류(과학 및 기술 서비스)가 31.6%로 가장 높은 증가율을 보였고, 이어 41 류(교육 및 엔터테인먼트)가 24.0%, 9 류(컴퓨터 및 기술 제품 등)가 17.6%의 증가율을 기록했다. 이는 대만인이 기술 제품 서비스, 엔터테인먼트, 문화 및 창조 산업 분야에 적극적으로 투자하고 있음을 보여준다. 다만 29 류(육류 및 견과일 및 채소 등)만 0.6%의 소폭 감소세를 보였다.

외국인의 경우, 9 류가 4,063 개 품목으로 가장 많았다. 상위 10 개 분야 중에서는 28 류(장난감, 게임 등)가 16.6%로 가장 높은 성장률을 기록했으며, 다른 분야들도 1.8%에서 8.7% 사이의 증가율을 보였다. 다만 30 류(커피, 차, 제과류 등)는 4.3% 감소했다.

5. 전리(專利) 및 상표 심사 과정에서의 지속적인 최적화는 기업의 산업입지를 강화하는데 도움이 된다.

지혜국은 전리(專利) 및 상표 심사의 효율성을 개선하는 데 전념하여, 출원인이 제품 개발부터 상용화에 이르기까지 발생하는 모든 단계의 요구를 충족하려 하고 있으며, 아울러 다양한 신속 심사 제도를 제공하려 한다. 2025 년 특허의 평균 최초 승인 기간은 8 개월로 2024 년 대비 0.4 개월 단축될 예정이다. 상표의 평균 최초 승인 기간은 0.5 개월 단축된 5.6 개월로, 기업들이 최대한 빨리 권리를 확보하고 시장에서의 산업적 입지를 강화할 수 있도록 지원할 것이다. (2026.02)

역주:

- 1) 대만의 경제부 지혜재산국(經濟部智慧財產局)을 지칭하며 대만의 지식재산권을 담당한다.
- 2) 전리(專利)의 종류에 發明專利(특허권 상당), 新型專利(실용신안권 상당), 設計專利(디자인권 상당)가 있다. 이는 한국의 산업재산권에 대응한다고 볼 수 있다. 그런데, 한국은 산업재산권에 상표권을 포함하는 반면, 대만에서는 상표권이 별도로 분류, 관리된다. 여기서는 편의상 專利는 전리(專利)로 發明專利는 특허로 번역했다.

Attorneys-at-Law

K260223Y1

03 Everlight 가 미국에서 한국 LED 공급업체를 특허 침해 혐의로 고소

대만 LED 패키징 제조업체인 Everlight¹⁾는 2026 년 2 월 22 일, 미국에서 한국 LED 공급업체인 서울반도체 ²⁾를 상대로 특허 침해 소송을 제기했다고 발표했다. 소송은 2 월 13 일 미국 텍사스주 동부 연방지방법원 마샬지부 ³⁾에 접수되었으며, 법원은 이를 수락했다. 관련 사건 번호는 Case 2:26-cv-00119 이다.

Everlight 는, 서울반도체가 제조 및 판매하는 자동차용 LED 및/또는 고성능 LED 제품이 자사의 미국 특허 제 7,554,126 호를 침해한 것으로 의심된다고 밝혔다. 특허 침해 행위를 중단시키고 회사 및 모든 주주의 정당한 권익을 보호하기 위해, Everlight 는 서울반도체를 상대로 특허 침해 소송을 제기하여, 피고의 특허 침해 행위 중단 및 손해 배상 책임을 명령해 줄 것을 법원에 요청했다.

초기 평가에 따르면, 이번 사건은 현재까지 회사의 재정 상태 및 전반적인 운영에 큰 영향을 미치지 않았다고 한다. 향후 영향은 소송 진행 상황과 법원의 최종 판결 결과에 따라 달라질 것이다. (2026.02)

역주:

- 1) 중국어명 億光電子工業股份有限公司, 영어명 Everlight Electronics., Ltd. (Everlight)
- 2) 한국어명 서울반도체, 영어명 Seoul Semiconductor Co., Ltd.(서울반도체)
- 3) District Court for the Eastern District of Texas Marshall Division 를 지칭

K260213Y8

K260213Z8

04 대만과 미국이 상호 무역 협정 체결을 완료, 양국 경제 전략적 동반자 관계 강화

대만 경제부 국제무역국 ¹⁾은 대만과 미국이 2026 년 2 월 12 일 미국 동부시간으로 워싱턴 D.C.에서 「상호무역협정 (Agreement on Reciprocal Trade, ART)」에 서명했다고 보도자료를 통해 밝혔다. 이 협정은 관세 및 비관세 무역 장벽, 무역 원활화 촉진, 지식재산권 보호 강화 그리고 경제 안보 및 노동 보호 등 다양한 분야에서의 협력 확대 등을 포괄한다.

비관세 무역 장벽과 관련하여 양측은 국제 표준 및 규범에 따라 집행할 것이다. 예를 들어, 상품 검사 측면에서 향후 미국산 제품은 수입 시 추가 검사 면제를 받기 전에 국제적으로 인증된 시험기관에서 국제 기준에 따라 검사 및 승인을 받아야 한다.

대만은 국제 표준 및 규범을 통한 엄격한 감독 외에도 상품 위험도를 고려하여, 무작위 국경 검사 빈도를 높이고, 시장 검사 및 표본 검사의 종류와 규모를 확대하여 상품 안전을 확보할 것이다.

대만은 지적재산권 보호와 관련하여 오랫동안 국제 표준을 충족해 왔으며, 국제 관행에 발맞추어 관련 법률을 선제적으로 개정하고, 관련 국제 협약을 준수해 왔다. 이번의 협정은 대만이 국제 규범을 완전히 이행하고 있으며, 효과적인 민사, 형사 및 국경 집행 메커니즘을 갖추어 지적재산권 침해를 방지하고 억제하고 있음을 다시금 확인한 것이다. 나아가, 공평하고 투명한 방식으로 지명을 포함한 제품 라벨을 보호하여 지적재산권 소유자와 소비자의 권리를 보호할 것이다.

또한, 39 개의 치즈, 10 개의 가공육 제품 명칭이 있는데, 이는 치즈와 가공육 제품의 종류 또는 유형을 설명하는 데 사용된다. 이러한 명칭을 사용하는 제품은 자유롭게 수입할 수 있어 대만 소비자에게 더욱 다양한 제품 선택권을 제공할 것이다.

오랜 기간 동안 미국은 대만의 최대 기술 공급원이었다. 미국의 첨단 기술과 하이테크 제품이 다른 나라로 유출되어 대량살상무기등으로 개발되는 것을 막기 위해, 대만은 수출 통제 및 투자 심사 관련 법규를 지속적으로 개선하고 경제·국가 안보 협력을 강화해 나갈 것이다. 이는 대만과 미국의 기술 교류 및 대만의 기술 경제 발전을 위한 견고한 토대가 될 것이다.

아울러, 기업들이 국제적 변화에 적응할 수 있도록, 경제부는 지속적으로 제조업체를 지도하고, 정보 설명회 개최 등을 통해 대만 기업들이 국제 동향을 파악하고 법규를 준수할 수 있도록 지원함으로써, 대만 기업의 권익을 보호하고 국제 제재의 위험을 방지할 것이다.

대만과 미국 간 상호 무역 협정 체결은 양국 경제 무역 교류를 더욱 강화하고, 대만과 미국 간 경제 전략적 동반자 관계를 심화시키며, 대만의 경제 무역 정책이 국제 기준에 완전히 부합하도록 지원하여, 대만 경제의 지속적인 발전을 위한 견고한 토대를 마련할 것이다.(2026.02)

역주:

- 1) 원문의 經濟部國際貿易署를 지칭

Attorneys-at-Law